

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成27年12月24日 (2015.12.24)

【公開番号】特開2015-26688(P2015-26688A)
 【公開日】平成27年2月5日 (2015.2.5)
 【年通号数】公開・登録公報2015-008
 【出願番号】特願2013-154703(P2013-154703)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

H 0 1 L 21/68 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/68 N

H 0 1 L 21/304 6 4 8 G

H 0 1 L 21/68 F

【手続補正書】
 【提出日】平成27年11月9日 (2015.11.9)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 0 9 】

本発明はこのような事情の下になされたものであり、その目的は、投光部及び受光部の汚染を避けつつ、基板の姿勢を検出することが可能な液処理装置を提供することにある。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 1 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 1 9 】

回転軸 2 2 2 は、保持ピン 2 2 1 の上端部が回転プレート 2 1 の径方向内側へ向けて移動する方向に付勢されており、この付勢力により他の保持ピン 2 2 1 との間でウエハ W を挟み、回転プレート 2 1 の上面との間に隙間を開けた状態でウエハ W を水平に保持する。各作動片 2 2 3 の下方位置には、連結板 2 5 3、棒状の昇降部材 2 5 2 を介して昇降機構 2 5 4 に連結された円環形状の押上板 2 5 1 が設けられている。この押上板 2 5 1 を上昇させて、作動片 2 2 3 を押し上げると、回転軸 2 2 2 周りに保持ピン 2 2 1 が回転し、回転プレート 2 1 の径方向外側へ向けて保持ピン 2 2 1 が移動することにより、ウエハ W の保持が解除される（図 4）。